

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-145520

(P2001-145520A)

(43) 公開日 平成13年5月28日 (2001. 5. 29)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームコード <sup>*</sup> (参考)
A 4 5 D 44/12		A 4 5 D 44/12	C 4 C 0 8 1
A 6 1 L 15/58		A 6 1 N 5/06	A 4 C 0 8 2
A 6 1 N 5/06		A 6 1 L 15/06	

審査請求 未請求 請求項の数4 書面 (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平11-367701

(22) 出願日 平成11年11月19日 (1999. 11. 19)

(71) 出願人 500003198

シャリオン株式会社

東京都新宿区新宿1-31-16

(72) 発明者 羽村 文男

東京都新宿区新宿1-31-16 シャリオン  
株式会社内

Fターム(参考) 4C081 AA09 AA12 BB03 BC02 CB042

CB051 CE01 CE02 CF22

DA01 DA02 DC03 DC12

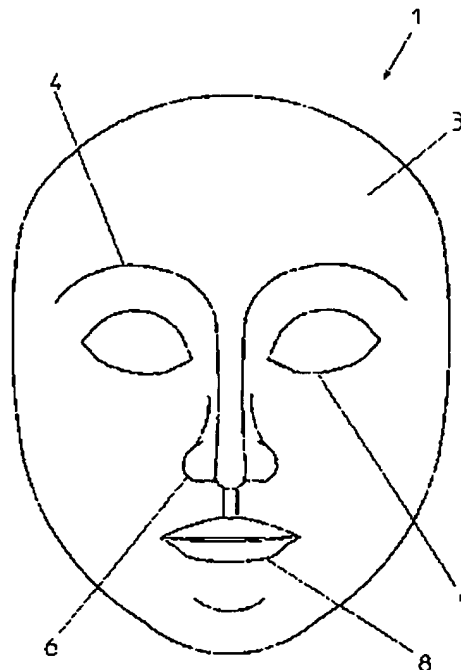
4C082 PA01 PC10 PC02 PJ21

(54) 【発明の名称】 遠赤外線マスク

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 遠赤外線を発生させ、肌を養生、活性化して、香りも楽しめるマスクを提供する。

【解決手段】 マスクの内面を顔の顔に沿った凹面に成す。加温することで遠赤外線を発生する、鉱物又はセラミックスの粉末を、マスクの材料の耐熱プラスチック系ゴムに加えてマスクを形成する。マスクの内面を微細な凹凸の面に成して、保水性のある面を得て香水をつける。又はマスクを形成する材料に香料を練入して、香りのあるマスクを得る。マスクの内面表皮部分、又はマスク全内部に、抗菌剤を練入して衛生的なマスクを形成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 人の顔にかぶせて保温発汗を促し、美顔  
瘦身に用いるマスクにおいて、加温によって遠赤外線を  
発生する鉱物、セラミックスの粉末を練入した、耐熱プ  
ラスチック系ゴムでマスクを形成したことを、特徴とす  
る遠赤外線マスク。

【請求項2】 前記、マスクの内面を微細な凹凸面に成  
して、保水性の有るマスク内面を、特徴とする請求項1  
の遠赤外線マスク。

【請求項3】 前記、マスクを形成する材料と、更に抗  
菌材料を使用し形成したことを、特徴とする請求項1  
の遠赤外線マスク。

【請求項4】 前記、マスクの表面を、人肌様の凹凸  
と、人肌様の滑らかさに成して、人の顔のごとくマスク  
表面を、化粧可能に形成したことを特徴とする請求項1  
の遠赤外線マスク。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、入浴の時など、顔  
にかぶせて発汗を促すなどして、美顔瘦身に利用する化  
粧用具等に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、美顔の目的で蒸しタオルを顔にか  
ぶせて暖め肌を潤し、又遠赤外線を発生する泥を顔に塗  
って肌を暖め、細胞を活性化するなどが行われている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】従来の美顔瘦身の目的  
で入浴時などに、暖めたタオルを顔に当てて発汗を促  
し、肌を潤す場合は、タオルの湿もりが冷めやすく、遠  
赤外線の発生なども期待できない。遠赤外線を発生する  
泥を顔に塗る等の方法も採られるが、この場合は自分自  
身で顔に塗って用いることは容易ではない。これらの課  
題を解決して、自分自身で容易に扱い得て、遠赤外線を  
発生させ、肌を養生、活性化する顔面用のマスクを供す  
ることを目的としたものである。

【0004】

【課題を解決するための手段】前述した課題を解決して  
上記目的を達成するために、本発明は次の技術的手段を  
講じたものである。請求項1は、マスクの内面を概ね人  
の顔に沿った凹面に成す。マスクを形成する材料は、加  
温することによって遠赤外線を発生する、鉱物又はセラ  
ミックスの粉末をマスクの材料に加えて、マスクを形成  
する。

【0005】請求項2は、マスクの内面を成形する型に  
予め微細な凹凸をつけてマスクを成形し、マスク内面を  
微細な凹凸の面に成して、保水性のある面を得る。請求  
項3は、マスクを成形する場合に、マスクの内面表皮部  
分、又はマスク全肉部に、抗菌剤を練入する。

【0006】請求項4は、マスクの外側表面を成形する  
型に、予め人顔の彫りの凹凸をつけてマスクを成形す

る。マスクの外側表面を形成する部分が人肌程度の硬  
度、滑らかさを持つように成して、普通に市販の化粧品  
でも、マスクに化粧して楽しむことを可能とする。

【0007】

【発明の実施の形態】本発明は、マスクの内面を概ね人  
の顔に沿うように成し、マスクを形成する材料は、加温  
して遠赤外線を発生する鉱物等の粉末を、材料に加えて  
マスクを形成し、入浴時などにお湯で暖めて顔にかぶ  
せ、発生する遠赤外線が発汗を促し、細胞の活性化に寄  
与して肌を養生する。マスクの内面を成形する型に予め  
微細な凹凸をつけてマスクを成形して、マスク内面を微  
細な凹凸の面に成し、保水性のある面を得る。内面に香  
水を塗って保持、持続して香りを楽しむ。又化粧水を塗  
って置いて、間接的に顔の肌へ移して肌の養生をする。  
マスクを成形する場合に、マスクの内面表皮部分、又は  
マスク全肉部分に、抗菌剤を練入、又は塗るなどして抗  
菌効果を得て、衛生的なマスクを得る。マスクの外表面  
を成形する型に、予め人の面相の彫りをつけてマスクを  
成形し、外表面が人肌程度の硬度と、滑らかさを持つよ  
うに成形して、マスクに化粧する楽しみ、化粧したマス  
クを仮面にして変身を楽しむことも可能にする。

【0008】

【実施例】以下、本発明を図面に示した実施例により説  
明する。「図1」、「図2」、「図3」に、実施例を示  
した。本発明は次の技術的手段を講じたものである。す  
なわち、遠赤外線マスク1の成形は、マスク内面2側、  
つまりマスク成型型の表側を概ね人の顔の凸面に成し、  
マスク表面3、つまりマスク成型型の内側を人の顔の形  
で凹面に成して、型を合わせた状態で全体に適宜隙間が  
出来るように型を作成する。加温することによって遠赤  
外線を発生する、鉱物を粉末にして、マスクの材料、実  
施例ではプラスチック系耐熱ゴムに練り加えて、前記型  
により成形して、遠赤外線マスク1を作る。

【0009】遠赤外線マスク1のマスク内面2を成形す  
る型に予め微細な凹凸をつけて成形してマスク面に写  
し、マスク内面2を微細凹凸面9に成して保水性を得  
る。遠赤外線マスク1の成形で、マスク内面2の表皮部  
分、又は遠赤外線マスク1全肉部に、抗菌剤を練入し  
て、抗菌性のある遠赤外線マスク1を形成する。遠赤外  
線マスク1のマスク表面3を成形する型は、人顔の彫り  
で凹面に仕上げて、マスクを成形する。又遠赤外線マス  
ク1の外表面、マスク表面3は、その硬度を人肌程度の  
柔らかさにし、且つ人肌程度の滑らかさを持つように成  
形する。マスク表面3は、人肌様の柔らかさ、滑らかさ  
を得、普通の市販の化粧品で化粧出来て、マスクを化粧  
して楽しむこと、化粧したマスクを仮面にして、遊び心  
で付けて楽しむことを可能とした。又遠赤外線マスク1  
の成形で、マスク内面2の表皮部分、又は遠赤外線マス  
ク1全肉部に香料を練入し、当初より香りの有る遠赤外  
線マスク1を形成することも可能である。

## 【0010】

【発明の効果】遠赤外線マスクのマスク内面を人の顔の形に成形して、マスク成形材料は、加温することで遠赤外線を発生する鉱物を粉末にし、プラスチック系耐熱ゴムに練り加えて、遠赤外線マスクを形成する。遠赤外線マスクを予め、お風呂のお湯に浸けて暖めて置いて、入浴しながら顔に付ければ、マスクから発する遠赤外線

で、発汗や細胞の活性化など、肌の養生が期待できる。【0011】遠赤外線マスクのマスク内面に微細な凹凸をつけて成形し、マスク内面の微細な凹凸の面で、香料などの保持性を良くし、香料を付けて香りを楽しみながら入浴できる。同様に、マスク内面の微細な凹凸面に、化粧水を付けて用いれば、遠赤外線の効果と相まって肌の活性化、養生が期待できる。マスク内面の表皮部分、又はマスク全内部に、抗菌剤を練入して、抗菌性のある常時衛生的なマスクを得ることが出来る。マスク表面を人顔の彫りに仕上げてマスクを成形し、その硬度を人肌程度の柔らかさに、且つ人肌程度の滑らかさに成して、\*

\*普通の市販の化粧品で化粧出来るように成して、マスク表面に化粧して楽しむこと、化粧したマスクを仮面のよう

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の遠赤外線マスクの正面図である。

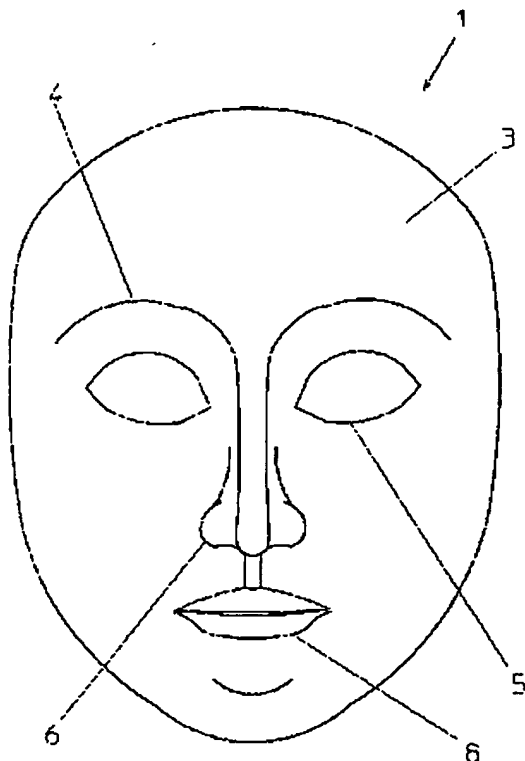
【図2】図1の左側面図である。

【図3】図1の左側断面図である。

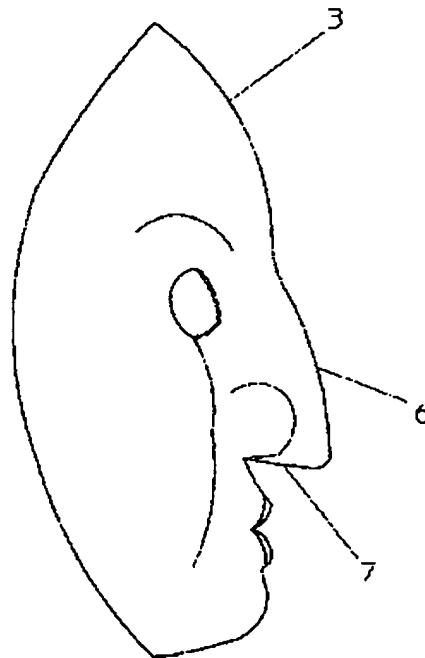
【符号の説明】

- 1 遠赤外線マスク
- 2 マスク内面
- 3 マスク表面
- 4 眉形
- 5 目形穴
- 6 鼻形
- 7 鼻穴
- 8 口ビル形
- 9 微細凹凸面

【図1】



【図2】



(4)

特開2001-145520

【図3】

